### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

#### (43) 国際公開日 2005年10月6日(06.10.2005)

PCT

## (10) 国際公開番号 WO 2005/093722 A1

(51) 国際特許分類7:

G11B 5/84

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/005650

(22) 国際出願日:

2005年3月22日(22.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-091203 2004年3月26日(26.03.2004)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): パイオ ニア株式会社 (PIONEER CORPORATION) [JP/JP]; 〒1538654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号 Tokyo (JP).

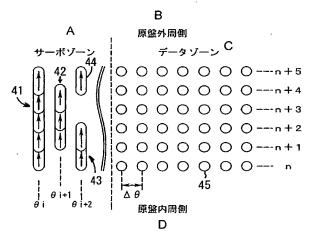
(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 勝村 昌広 (KAT-SUMURA, Masahiro) [JP/JP]; 〒3502288 埼玉県鶴ヶ 島市富士見6丁目1番1号パイオニア株式会社総 合研究所内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 藤村 元彦(FUJIMURA, Motohiko); 〒1040045 東京都中央区築地4丁目1番17号銀座大野ビル藤 村国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,

/続葉有/

(54) Title: ELECTRON BEAM RECORDING DEVICE

(54) 発明の名称: 電子ビーム記録装置



A SERVO ZONE

B ORIGINAL DISK OUTER PERIPHERAL SIDE

C DATA ZONE

D ORIGINAL DISK INNER PERIPHERAL SIDE

(57) Abstract: An electron beam recording device and method have control means and beam regulation means. The control means forms on a resist layer a latent image corresponding to a predetermined pattern. To form the image, the control device controls a position to which an electron beam is irradiated by an electron beam irradiation section, the position being on the surface of the resist layer and being controlled according to the angle of rotation of an original disk by a rotation drive section, the position of movement by a movement drive section, and recorded data representing a predetermined pattern. The beam regulation means causes the electron beam to be irradiated according to the irradiation position control by the control means, where the electron beam is irradiated in the direction traversing tracks and so as to straddle the tracks.

回転駆動部による原盤の回転角度、移動駆動部による移動位置及び所定のパターンを示す記録データ に応じて電子ビーム照射部によるレジスト層の表面上の照射位置を制御し



#### 

- NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
- OAPL (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。